ねじれ振子における量子渦糸の生成

岡山理科大学・理学部 藤井佳子、信貴豊一郎、小川智之 重松利信、中村改樹、山口稔

1、はじめに

超流動へリウムの入ったバケツを回転させるとき、角速度Ωがある臨界値を超えると回転軸 に平行な方向に並んだ渦糸が生じ、その本数は単位面積あたり $2\Omega/\kappa$ で与えられる。ここで $\kappa = h / m$ ($h: プランク定数、<math>m: {}^4H$ e 原子の質量)であり、超流動ヘリウム中の渦度は κ を単位として量子化されている。1)一方、細管中に超流体と常流体の熱カウンター流を生じさ せた場合、両者の相対速度がある臨界値を超えると渦糸が発生する。この渦糸は細管中で複雑 に絡み合った状態になっていると考えられている。²⁾

さて、1 K H z 程度の周波数で、しかも1 μ m程度の僅かな振幅で振動する容器中の超流動 ヘリウムには、どのような状態の渦糸が生じるであろうか。我々は、高いQ値をもつねじれ振 子を使って、その固有振動数の変化を測定することにより渦糸の生成の様子を調べた。

超流動4He中の渦糸についての理解は、渦糸密度が十分大きい場合にはかなり深まってきた が、 $^{1,2)}$ 渦糸はいかにして発生するのかという問題については、未だ分からない点が多い。

2、測定と結果

測定装置の構造を図1に示す。全体は、黄銅 ブロック、トーションロッド、サンプルセル、 バイアス電極、ドライブ電極、ディテクト電極 よりなりたっている。黄銅ブロックは振子のね じれ運動の支点となるものであり、振子のねじ れ軸に対する黄銅ブロックの慣性能率は、振子 の慣性能率と比べて3桁以上大きく作ってある。 トーションロッドは振子のQ値を決める重要な 部分であり、BeCuを加工後熱処理して剛性 率を高めた。円筒状のサンプルセルは、後述す るようにサイズを変えて測定した。基本となる サイズは、内径16mm、高さ16mmである。 セルはエポキシ樹脂スタイキャスト1266で 製作し、旋盤加工後、内壁にスタイキャスト

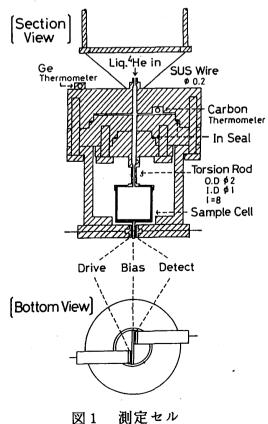


図 1

1266を塗って滑らかな壁 面とした。ドライブおよびで電極は、バイインがは、スで電極を狭ってででででででででででででででででででででででででででででででででででが、サンマーのの温度では、ゲーベン抵抗温度計で行った。からな4Heに浸されているカーボン抵抗温度計で行った。

振子を自励振動させ、その 固有振動数を測定する電気回 路を図2に示す。ドライブ電圧を 変化させると、セルの振幅が変わ る。セルの振幅は、ディテクト側 に流れる電流とバイアスーディテ クト電極間の間隔より求められ、 振幅と振動数よりセルの壁の平均 速度がわかる。

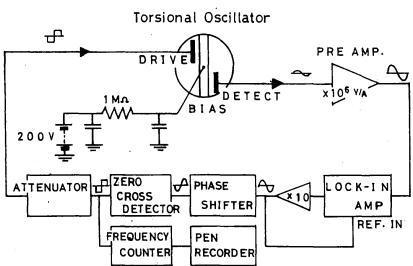


図2 ねじれ振子を自励振動させる電気回路

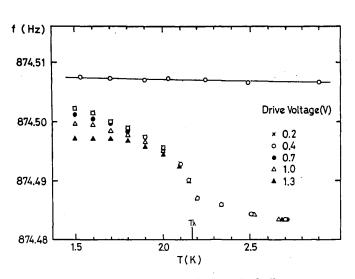


図3 固有振動数の温度変化

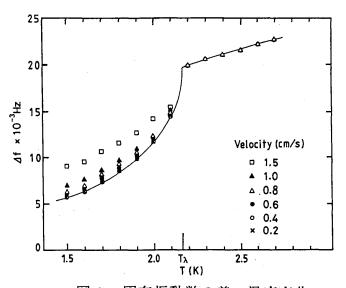


図4 固有振動数の差の温度変化

パラメータをドライブ電圧からセルの 壁の平均速度に変えて示したのが図4 である。 Δ f は液によって生じる振子 への負のトルクの大きさに比例する量 である。図の実線は、TA以上の測定 点およびTA以下において壁の平均速 度が0.4cm/s以下のときの測定 点を連ねたものである。この実線の値 より液の粘性率を求めると、Welber³⁾ が測定した常流体の粘性率(TN以上 では液体の粘性率)と2%以内の精度 で一致することがわかった。⁴⁾壁の平 均速度がある臨界値を超えると、TA 以下では量子渦糸が発生し、これによ りセルの壁は余分な負のトルクを受け ると考えられる。セルの壁の平均速度 が臨界値以下の時のΔfを改めてΔfa と書くと ($\Delta f - \Delta f a$) は渦糸がセル に及ぼす負のトルクに比例する量を示 す。図5は、(Δf-Δfa)が壁の平 均速度vの増加につれ増える様子を温 度をパラメーターとして示したもので ある。 v が約 0.5 c m/s で渦糸が検 出されるようになることがわかる。 1.5 Kから2.0 Kの間では温度依存

振子の中に生じている渦糸の分布について、図6に示すように2つのモデルが考えられる。モデル(a)は粘性侵入深さ程度(1μmのオーダー)の幅の中にのみ絡み合った渦糸が定常的に存在するというものであり、モデル(b)は粘性侵入深さのところで発生した渦糸が1本に連なりセルの内部に

性は小さい。

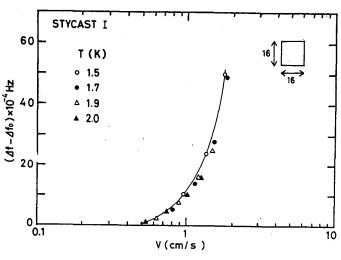


図5 (Δf-Δf0)と壁の平均速度

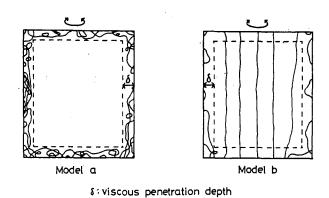


図6 ねじれ振動するセル内の渦糸の分布

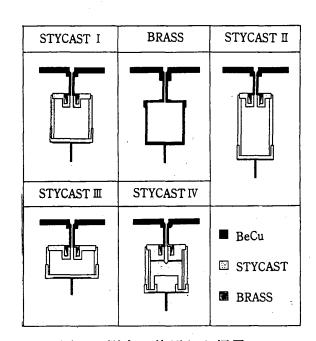
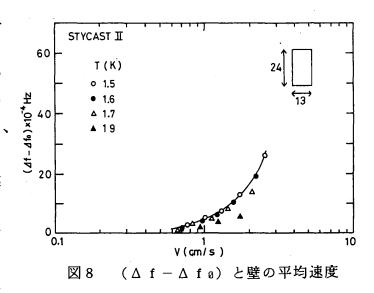
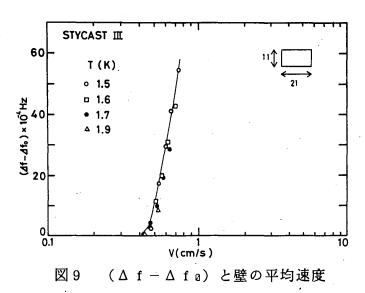


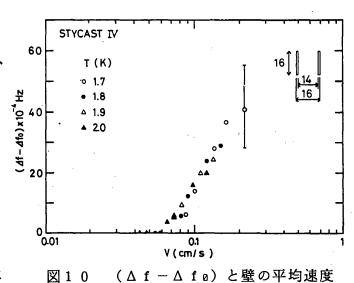
図7 測定に使用した振子

拡散していき、渦糸の両端がセルの上 下にある程度ピン止めされた状態にな っているというものである。どちらの 状態であるのかという情報を得るため に、図7に示すような形のセルを作り、 同様の測定を行った。スタイキャスト セルⅠは基本形であり、これまでに述 べてきた結果はこのセルで測定したも のである。スタイキャストセルⅡは内 径13mmø、長さ24mmの縦長の セルで、スタイキャストセルⅢは内径 21mmø、長さ11mmの偏平のセ ルである。これら3つのセルの内表面 積はほぼ同じである。スタイキャスト セルⅣは、同心円筒形で、外側の円筒 のサイズはセルIと同じであり、内側 円筒との隙間は1mmである。隙間の 大きさは粘性侵入深さに比べて十分大 きい。残りの黄銅製セルのサイズはセ ル I と同じである。黄銅の内壁は旋盤 加工したままの状態であり、スタイキ ャスト壁に比べ粗く、数μm程度の筋 が入っている。

図8にスタイキャストセルIIの結果を、図9にセルIIの結果を示す。図5、8、9を比較すると、渦糸が検出されはじめるVはほぼ同じであることがわかる。しかし、渦糸がセルに及ぼす負のトルクの増加の様子はセルの形に大きくなる。図10にセルIVの結果を示す。この場合、渦糸はVが約0.05 cm/sにおいてすでに検出される。($\Delta f - \Delta f a$)のVに対







する傾きは、セルIとほぼ同じであるが、測定点のバラツキが大きく、vが 0.15~c m/s 以上では f の不安定性は図にエラーバーで示した程大きくなる。図11 に黄銅製セルの結果を示す。渦糸はv が約0.2~c m/s で検出され、この値はセルI に比べ小さい。しかし、v の増加に対する ($\Delta f - \Delta f a$) の増え方は非常に緩やかである。

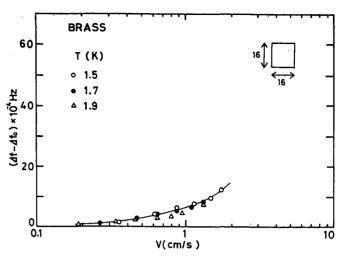


図11 (Δf-Δfα)と壁の平均速度

3、考察

次に、同心円筒状スタイキャストセルIVの結果について考える。渦糸が検出される v(臨界速度と呼ぶことにする)はセル I に比べ約 1 桁小さく、この結果は液の入っている空間が狭いと臨界速度が小さいことを示している。我々の実験において、渦糸または渦輪が発生する主となる条件については、現段階では明かでないので、臨界速度について詳しく議論することはできないが、一方向に回転する容器における臨界角速度の議論では、 5 同心円筒の隙間が小さい程臨界角速度は大きくなることを考えると、我々の結果はこれとは矛盾する。セルIVの測定において、v が大きくなったとき固有振動数のフラッキが大きくなったが、これは、液の入っている空間が小さいので渦糸の密度が他のセルに比べて大きくなり、渦糸間の大きな相互作用のために渦糸密度の揺らぎが大きくなったためであろうと推測している。今後、揺らぎの様子について詳しく調べる必要がある。

最後に、黄銅製セルの結果について考える。スタイキャスト製セルIと比較すると、臨界速

研究会報告

度は小さいが、vの増加に対する($\Delta f - \Delta f e$)の増加は非常に揺るやかである。壁面の粗い黄銅製セルでは、壁面近くの速度場の一様性や渦糸のピン止め力が滑らかな壁面の場合とは異なる。 $^{6)}$ このため側壁に生じた渦糸が1本に連なってセル内部にはじき出される確率が、壁の粗いセルでは小さいと考えられる。

渦糸が壁面に及ぼすピン止め力を定量的に取り扱うためには、⁷⁾ 今後、壁の粗さを体系的に変えて測定する必要がある。また、超流動ヘリウムをセル一杯に満たした状態と、自由表面をもつ状態とで測定し比較する必要がある。

(参考文献)

- 1) R. J. Donnelly: Quantized Vortices in Helium II, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1991).
- 2) J.H. Tough: Progress in Low Temperature Physics Vol. 8, North Holland, Amsterdam (1982) Chap. 3.
- 3) B. Welber: Phys. Rev. 119 (1960) 1816.
- 4) 藤井佳子、小川智之、竹迫憲浩、重松利信、中村改樹、山口稔、信貴豊一郎: 低温工学 29 (1994) 97.
- 5) 参考文献1)のp67.
- 6) S.G. Hegde and W. I. Glaberson: Phys. Rev. Lett. 45 (1980) 190.
- 7) P.W. Adams, M. Cieplak and W. I. Glaberson: Phys. Rev. B32 (1985) 171.